

## CVD-handy<sup>®</sup>/tube



# CVD-handly tube

## ÜRÜN BİLGİSİ

Düşük Basınç Kimyasal Buhar Biriktirme Sistemi (LPCVD), gaz türlerinin yonga veya katı yüzey üzerinde etkileştikleri diğer Kimyasal Buhar Biriktirme Sistemleri ile benzerdir. LPCVD prosesi tüp fırına eşmerkezli bir şekilde yerleştirilen kuvars tüpe sahiptir. LPCVD, homojen kalınlık ve saflık, kolay kullanım, büyütülen tabakaların homojen olması ve yüksek üretilebilirlik gibi avantajlara sahiptir.

Yüksek sıcaklık CVD sistemi olan "CVD-handly tube" serisi ile grafen, karbon nanotüp ve nanoteller (ZnO, GeO) başarılı bir şekilde biriktirebilmektedir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

En Düşük Basınç .....	$\approx 10^{-6}$ Torr
Kuvars Tüp Çapı .....	Maks. 130 mm
Maksimum Sıcaklık .....	1100°C
Sürekli Çalışma Sıcaklığı .....	1050°C
Isıtma Bölgesi Uzunluğu .....	250 mm
Sıcaklık Kontrol Sistemi .....	PID Yöntemiyle
Soğutma .....	Kaldırma Mekanizmasıyla Hızlı Soğutma
Yükleme .....	Kuvars Tüpün bir ucundan
Kontrol .....	Tam Otomatik (Yarı Otomatik Opsiyoneldir)
Farklı Gaz Türleri için Kütle Akış Kontrolcü Sayısı .....	İMaks. 12

Talep edilirse, CVD-handly tube sistemimiz **İndüktif Eşleşmiş Plazma (ICP) ile birleştirilebilir.**

## YAZILIM

Sistem operasyonu kolay kullanılabilir bir yazılıma sahiptir. Bu, sadece otomasyon ve kontrol yazılımı değil, ayrıca kullanıcının özel kaplama deneyimlerini tasarlayabildiği, daha önceden kullanılan proses parametrelerini inceleyebildiği ve geliştirilmiş reçeteleri/kaplamaları kullanabildiği bir yazılımdır.

Yazılım tarafından yürütülen operasyonlarda insan ve makine güvenliği önem açısından ilk sıradadır. Grafik kullanıcı arayüzü kullanıcıya kullanım sırasında sistem durumunu görme imkanı sunmaktadır.